# 可視光で金属 – 絶縁体転移を示す 新しい酸化チタン薄膜の合成と相転移観測

東北大学 多元物質科学研究所 吉松公平

# New Titanate Films that Show Metal-insulator Transition by Visible-light Irradiation

# Kohei Yoshimatsu IMRAM, Tohoku University

新しい酸化チタンλ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は、室温かつ可視光照射で光誘起相転移を示すことから、 書き込み可能な光記録媒体への応用が期待されている。しかし、室温準安定相の特徴から ナノサイズの多結晶体しか合成できず、相転移に伴う物性変化を明らかにできていない。 本研究では速度論的平衡の強い薄膜を用いることでλ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の単結晶薄膜合成に成功 し、その構造と基礎的な光物性を明らかにした。さらに大面積かつ単結晶の特徴を活かし、 温度や光刺激による相転移発現を観測し、相転移に伴う構造および電気抵抗変化を明らか にした。

A new titanate of  $\lambda$ -phase Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> shows a visible-light induced phase transition at room temperature. The phase transition can be applied for the re-writable optical recording media. Due to the metastable nature,  $\lambda$ -phase Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> is only obtained in the form of nano-sized polycrystals, which hinders the intrinsic physical properties across the phase transition. In this study, we have succeeded in synthesizing a single-crystalline  $\lambda$ -phase Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> in the thinfilm form and have revealed its structural and optical properties. In addition, photo- and temperature-induced phase transitions, which was characterized by structural and electrical changes, were observed using the sizable and single-crystalline  $\lambda$ -phase Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> films.

## 1. はじめに

近年,新しい光・電子材料として Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の組成を持つ準安定な酸化チタンが注目され ている。Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は5つの結晶多形(a, $\beta$ , $\gamma$ , $\delta$ , $\lambda$ 相)を持ち、これらはさらにa, $\beta$ ,  $\lambda$ 相と $\gamma$ , $\delta$ 相の2つに分類される<sup>1,2)</sup>。本研究に関係する前者の関係性を図1に示す。 a相は高温の安定相であり, $\beta$ 相と $\lambda$ 相はともに約460K で a相へと相転移する。室温で は $\beta$ 相が最安定で, $\lambda$ 相は準安定である。 $\lambda$ 相と $\beta$ 相の間は光<sup>2)</sup>や圧力刺激<sup>3)</sup>により相転 移を示す。

Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は結晶多形に起因した多彩な相転移を示すが、その中でも室温かつ可視光照射で 起こす光誘起相転移は光記録媒体への応用が期待されている。しかし、λ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は準 安定物質のためにナノサイズの多結晶試料しか合成できておらず、基礎的な光・電子物性 すら明らかになっていない。そこで本研究では、大面積かつ単結晶の薄膜の特徴を活かし、 電気特性や光学特性の物性評価と温度や光刺激による相転移の観測を行った。

研究当初は、準安定な  $\lambda$ 相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>をFe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>バ ッファ層により安定する ことを試みた。 $Fe_2TiO_5$ はTi<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の高温相である a 相と同一の結晶構造を 持ち、エピタキシャル安 定化により室温ではん相 が安定化すると期待され る。Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>バッファ層 の合成には格子ミスマッ チの小さな LaAlO<sub>3</sub> (100) 基板を選択した。種々の 温度と酸素圧力条件で Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>薄膜合成を検討 した結果、基板温度 900°C. 酸素分圧 10<sup>-5</sup> Torr の条件で(100)面直配向し



た単結晶 Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> 薄膜が得られた。そこで Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> バッファ層上に $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜の合成を試みたが、Fe 元素の拡散により単相の $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> は得られなかった。加えて、同時期に他の研究グループから MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> バッファ層を用いた $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> の安定化が報告された<sup>4)</sup>。そこで、Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> バッファ層導入をやめ、より有意義な $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜の直接合成に取り組んだ。

## 2. 実験方法

 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜はパルスレーザ堆積法を用いて合成した。基板には LaAlO<sub>3</sub> (110) 面を 用い,基板温度 1100°C, Ar 圧力 1×10<sup>-4</sup> Torr, 原料ターゲットには TiO<sub>2</sub> 単結晶を用いた。 薄膜作製直後に,Ar 圧力を保持したまま基板加熱の急冷を行なった。合成条件を検討し た結果,LaAlO<sub>3</sub> (110) 基板,1100°C の高温成長,薄膜堆積後の急冷プロセスが $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> の薄膜合成には非常に重要であることが明らかとなった。作製した薄膜は,Cu Ka<sub>1</sub>線を 用いた X 線回折測定と HAADF-STEM 測定により結晶構造を決定した。また,紫外可視 近赤外分光(UV-vis-NIR)測定とフーリエ変換型赤外分光(FT-IR)測定により紫外から赤外 領域の透過率と反射率を明らかにした。

#### 3. 結果と考察

#### 3.1 X線回折測定によるλ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>薄膜の構造決定察

図 2 (a) に  $\lambda$  相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄 膜の対称面 X 線回折パタ ーンを示す。薄膜由来の回 折ピークが 4 つ観測され、 低角側から  $\lambda$  相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> の 200,400,600,800 回折ピー クである。ここから、基板 面 直 に  $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> [100] // LaAlO<sub>3</sub> [110] の配向関係 でエピタキシャル成長して いることがわかる。 $\lambda$  相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄 膜 の a 軸 長 は 9.834Å と決定され、既報

のナノ結晶の値(a=9.838Å)とよく一致 した<sup>2)</sup>。

薄膜の結晶性は 200 回折ピークのωス キャンロッキングカーブ測定から評価し た [図2(b)]。ピークの半値全幅は 0.12°と準安定相としては非常に小さな 値が得られ、薄膜が高い結晶性を有する ことも明らかとなった。

 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> と LaAlO<sub>3</sub> 基板の面内配向 関係を明らかにするため、非対称面 X 線回折測定を行なった(図 3)。LaAlO<sub>3</sub> 基板の 100 と 010 回折に加え、 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の 20 ± 2 と 20 ± 3 回折が観測され ている。ここから、面内配向関係は $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> [001] // LaAlO<sub>3</sub> [1-10] となり、





格子ミスマッチによる予測と合致する。また、 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の 20 ± *l*回折の 2 $\theta$ 角が異なる ことから、 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜は $\beta \neq 90^{\circ}$ の単斜晶構造を持つことがわかる。単斜晶構造では、 ミラー指数 *hkl* を持つ回折の *d* 値(*d*<sub>hkl</sub>)と格子定数(a,b,c,  $\beta$ )は以下の関係式を満たす。

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{1}{\sin^2 \beta} \left( \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2 \sin^2 \beta}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} - \frac{2h \log \beta}{ac} \right)$$

対称面 X 線回折測定から得られた a 軸長と  $d_{203}$ ,  $d_{20-3}$  を用い、  $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の c 軸長と単 斜晶角  $\beta$  を決定した。その結果、c = 9.958Å,  $\beta = 91.23^{\circ}$ となり、  $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>ナノ結晶の 既報(c = 9.971Å,  $\beta = 91.26^{\circ}$ )とよく一致した <sup>2</sup>)。

非対称面X線回折パターンから、試料全体の薄膜構造に関する情報も得られる。図3

を見ると、面内回転軸の = 0°と180°で測定した 2つの非対称面X線回 折パターンで、201と20-1 (*l*=2,3)の一方のみが観 測されている。一般に単 斜晶構造の薄膜を LaAlO<sub>3</sub>のような(擬)立 法晶基板上に成長する と、対称性の不一致から 薄膜には180°回転ドメ インが形成される。しか し図3のX線回折パタ ーンでは180°回転ドメ インが存在しないことを 示唆している。これは、 λ相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜が基板の ステップ端によりドメイ ン制御された結果と考え られる5)。基板は加工時 のミスカットなどによ り、テラス間で1原子層 以上の高さを持つ 90°の 段差が生じる。 単斜晶 薄膜は結晶角の1つが 90°より大きく、基板の 段差と干渉が生じる。そ



のため、ステップ端では干渉を防ぐ向きに薄膜の結晶方位を揃える方が安定となる。この ような物理的なドメイン制御手法は、結晶の対称性が低い Fe, Cu, Ru 酸化物などで利用さ れており、単斜晶構造のλ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> においても同様の制御機構により回転ドメインが抑 制されたと考察される。

## 3.2 λ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>薄膜/LaAlO<sub>3</sub>界面の構造解析

 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜 /LaAlO<sub>3</sub> (110) 基板の界面構造を高角度散乱暗視野走査型透過電子顕微 鏡 (HAADF-STEM)により観測した(図 4)。基板・薄膜ともに構成カチオン1つ1つが明 瞭に観測されていることが見て取れる。HAADF-STEM 像ではZコントラストにより重元 素が明るく観測されることを考慮し、基板と薄膜の結晶構造との対応を検討した。その結 果を同様に図 4 に示す。 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の [001] 方向の投影像 [図 4 (a)] では、 $\lambda$ 相構造に特 有の Ti 原子のハニカム構造が観測され、[010] 方向の投影像 [図 4 (b)] では、Ti 原子の zigzag 構造が観測されている。薄膜 / 基板界面に着目すると、両方向ともに $\lambda$ 相に特有の 構造が基板直上から観測されており、Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>のようなバッファ層を用いることなく、準 安定なλ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>が直接成長できた本結果を支持している。

#### 3.3 λ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>薄膜の光学特性

光誘起相転移を示す $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は、光 学メディアへの応用が期待されている。 そのため、 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の光学特性を明ら かにすることは非常に重要である。膜厚 が 100 nm 程度の薄膜を用いることで、ナ ノ粒子試料では測定困難な透過率が定量 決定できる。図5に $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> は Ti の平 均価数が +3.33 と d 電子を持つため、可 視光領域に光吸収があることがわかる。 特に 1.5-2.5eV で反射率が大きく減少 しており、他の還元型酸化チタンでもみ られる d-d 遷移に伴う光吸収によるもの



と考えられる<sup>6)</sup>。4eV以上の透過率の大幅な減少は、λ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の電荷移動に伴う光吸収 に加え、基板のLaAlO<sub>3</sub>による光吸収の影響も大きいと考えられる。

### 3.4 λ相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>薄膜の温度・光刺激による相転移

図1に示すように、 $\lambda$ 相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は光・圧力・温度などの外部刺激で多彩な相転移を示 すことが知られている。そこで本研究で合成した $\lambda$ 相Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>薄膜を用い、温度と光によ る相転移の観測を行なった。温度による $\lambda$ 相からa相への相転移では、X線回折測定によ る構造変化と電気測定による抵抗変化を明らかにした。X線回折測定から約460Kを転移 温度とする単斜晶 $\lambda$ 相から直方晶a相への構造相転移が観測された。また、この構造相 転移は連続的で温度幅の広い二次の相転移であることも明らかとなった。電気測定では 350Kで電気抵抗率にキンク構造が見られ、二次相転移の開始によるものと考えられる。 350Kから転移温度の460Kまでは、電気伝導がMott variable range hopping モデル<sup>7)</sup>で フィッティングでき、Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>は結晶構造と電気抵抗の強い相関が明らかとなった。さらに 高温のa相では金属伝導が見られ、理論計算によるバンド幅制御の金属絶縁体転移の予 測と一致する結果が得られた<sup>8)</sup>。

光誘起相転移においては、Nd:Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (Nd: YAG) レーザを用いた永続的な相転移とフ エムト秒レーザを用いた過渡的な相転移の両面から観測を行った。永続的光誘起相転移 では、Nd: YAG の 2 倍波を薄膜試料に照射し、色変化と顕微ラマン分光測定から相転移 発現を観測した。しかし、 $\beta$ 相から $\lambda$ 相への相転移は色と構造の両面から明らかにでき ているものの、逆の相転移は発現せずに不可逆な現象の観測にとどまっている。過渡的 な光誘起相転移では、光照射によるピコ秒スケールでの透過率と反射率変化が観測され ている。今後、温度変化や偏向依存性の実験を進めることで光誘起相転移のメカニズム に迫れるものと期待している。なお温度と光による相転移に関しては、原著論文が未発 表であり要点のみの記載に留めた。

# 4. 結論

本研究では、新しい準安定酸化チタン $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の薄膜合成に取り組み、その結晶構 造と光学特性を明らかにした。パルスレーザ堆積法を用い、1100°Cの超高温と薄膜堆積後 の急冷プロセスにより、LaAlO<sub>3</sub> (110)基板上に高品質かつ単結晶の $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜合成に 成功した。X線回折からエピタキシャル関係が面直 $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> [100] // LaAlO<sub>3</sub> [110]、面内  $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> [010] // LaAlO<sub>3</sub> [001] であることを明らかにした。HAADF-STEM 測定から、 薄膜が基板直上から $\lambda$ 相に特有の構造を持ち、界面層を形成せずに直接成長していること が明らかとなった。光学測定では $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜の透過率と反射率を決定した。合成し た $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜を用い、温度と光刺激による相転移発現と観測を行った。これらの結 果は、 $\lambda$ 相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> の相転移を活用した次世代の光・電子デバイス実現に向けた重要な研 究成果といえる。

# 5. 謝辞

本研究は令和2年度日本板硝子材料工学助成会の研究助成を受けて行ったものである。 同助成会に心より感謝致します。

# 6. 参考文献

- 1) S. Åsbrink, L. Gerward, and J. S. Olsen, J. Appl. Cryst. 22, 119 122 (1989).
- 2) S. Ohkoshi, Y. Tsunobuchi, T. Matsuda, K. Hashimoto, A. Namai, F. Hakoe, and H.Tokoro, Nat. Chem. 2, 539–545 (2010).
- H. Tokoro, M. Yoshikiyo, K. Imoto, A. Namai, T. Nasu, K. Nakagawa, N. Ozaki, F. Hakoe, K. Tanaka, K. Chiba, R. Makiura, K. Prassides, and S. Ohkoshi, Nat. Commun. 6, 7037 (2015).
- 4) H. Chen, Y. Hirose, K. Nakagawa, K. Imoto, S. Ohkoshi, and T. Hasegawa, App. Phys. Lett. 116, 201904 (2020).
- 5) H. W. Jang, D. Ortiz, S. -H. Beak, C. M. Folkman, R. R. Das, P. Shafer, Y. Chen, C. T. Nelson, X. Pan, R. Ramesh, and C. -B. Eom, Adv. Mater. 21, 817–823 (2009).
- 6) T. Arima, Y. Tokura, and J. B. Torrance, Phys. Rev. B 48, 17006 (1993).
- 7) N. F. Mott, J. Non-Cryst. Solids 1, 1–17 (1968).
- 8) D. Olguín, E. Vallejo, and A. Rubio-Ponce, Phys. Status Solidi B 252, 659-662 (2015).